

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 3 部門第 1 区分
 【発行日】平成 21 年 1 月 29 日 (2009.1.29)

【公表番号】特表 2008-521749 (P2008-521749A)
 【公表日】平成 20 年 6 月 26 日 (2008.6.26)
 【年通号数】公開・登録公報 2008-025
 【出願番号】特願 2007-543890 (P2007-543890)
 【国際特許分類】

C 03 C 17/42 (2006.01)

【 F I 】

C 03 C 17/42

【手続補正書】

【提出日】平成 20 年 11 月 28 日 (2008.11.28)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

顕著な親水性を与える被覆、例えば少なくとも部分的に結晶性のチタン酸化物、特にアナターゼ形態のもの、を含む薄膜 (6) を、基板 (1) の一つの面の少なくとも一部に、有するガラス又はセラミックに基づく基板 (1) であって、

前記基板 (1) がシリコンタイプの成分を含むマスチック樹脂 (3) を基板 (1) の周辺の少なくとも一部に有し、さらに該シリコンの移動に対するバリア (5、7、8) が薄膜 (6) の表面 (2) に置かれていることを特徴とする基板 (1)。

【請求項 2】

シリコンの移動に対するバリア (5) が、シリコン系可塑剤を全く含まないエラストマー系マスチック樹脂、に基づくことを特徴とする請求項 1 に記載の基板 (1)。

【請求項 3】

エラストマー系マスチック樹脂 (5) が、シリルを末端基とするポリエーテルに基づくことを特徴とする請求項 2 に記載の基板 (1)。

【請求項 4】

バリア (5) として働くポリマーが、ビーズの形態で基板 (1) の表面 (2) に、シリコンタイプの化合物を含むマスチック樹脂 (3) と直接接触して、堆積されることを特徴とする請求項 2 又は 3 に記載の基板 (1)。

【請求項 5】

バリア (5) として働くポリマーが、ビーズの形態で基板 (1) の表面 (2) に、前記マスチック樹脂 (3) の向かい側で且つ数ミリメートルの距離を隔てて、堆積されることを特徴とする請求項 2 又は 3 に記載の基板 (1)。

【請求項 6】

シリコンの移動に対するバリア (8) が、基板 (1) の表面 (2) に置かれたノッチ (切り込み) 又はグループ (溝) から形成され且つシリコン (3) の源であるマスチック樹脂の向かい側にあることを特徴とする請求項 1 に記載の基板 (1)。

【請求項 7】

薄膜 (6) が少なくとも部分的に結晶性のチタン酸化物を含むこと、及びシリコンの移動に対するバリア (8) が、薄膜 (6) の周辺の縁取り (7) から形成され、前記縁取りはマスチック樹脂 (3) で被覆されていない縁取りした領域 (7) が存在するようにさ

れていること、を特徴とする請求項 1 に記載の基板（ 1 ）。